

B0319

### **INFLUÊNCIA DO MODO DE FOTOATIVAÇÃO E DA DISTÂNCIA DA FONTE FOTOATIVADORA NA MICRODUREZA E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DIAMETRAL DE COMPÓSITOS A BASE DE METACRILATO E SILORANO**

Barbara Bruna Malta Neves Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq), Renata Pereira, Maria do Carmo Aguiar Jordão Mainardi, Gláucia Maria Ambrosiano, Gisele Maria Marchi, Maria Cecília Caldas Giorgi (Co-orientadora) e Prof. Dr. Flávio Henrique Baggio Aguiar (Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do modo de fotoativação e da distância da fonte fotoativadora na microdureza Knoop (KHN) e resistência à tração diametral (DTS) de compósitos à base de metacrilato (Filtek Z250 – 3M ESPE) e silorano (Filtek P90 – 3M ESPE). As amostras foram fotoativadas com 0, 3 e 6 mm de distância, através das fontes halógena XL3000 Kerr Demetron (XL) e LED de terceira geração Valo Ultradent nos modos Standard (S), High Power (HP) e Plasma Emulation (PE). Após a confecção, as amostras foram submetidas à KHN nas superfícies de topo (T) e fundo (F) e à DST. Observou-se que Filtek Z250 apresentou valores de KHN iguais ou maiores que Filtek P90. A superfície T apresentou maiores valores de KHN que F. A distância da fonte fotoativadora foi significativa para superfície F, apresentando os menores valores de KHN quando fotoativado a 6 mm. Em relação à DTS, observou-se que os maiores valores foram obtidos para Filtek Z250. Independente da distância e do tipo de compósito, maiores valores de DTS foram obtidos quando fotoativado com XL e os menores com S, diferindo estatisticamente entre si e sem diferença estatística com os demais. Pôde-se concluir que o compósito a base de metacrilato apresentou melhores propriedades mecânicas que o a base de silorano.

Resinas compostas - Silorano - Fotoativação